1. **古河電工株式会社, 中村 教泰, 三好 弘一 :** 蛍光ナノシリカ粒子，ナノ蛍光材料，それを用いたバイオチップ及びそのアッセイ法, 特願2005-376401 (2005年12月), .
2. **古河電工株式会社, 中村 教泰, 三好 弘一 :** ナノシリカ粒子，それを用いたバイオチップ及びそのアッセイ法, 特願2005-376401 (2005年12月), .
3. **古河電工株式会社, 中村 教泰, 三好 弘一 :** フローサイトメーターによる生体分子の定量システム，その定量方法，細胞の検出・分取システム，その検出・分取方法，それらに用いる蛍光シリカ粒子，及び複数個の蛍光シリカ粒子を組み合わせたキット, 特願2006-049303 (2006年2月), .
4. **中村 教泰, 庄野 正行 :** 蛍光顕微鏡, 特願PCT/JP2007/60466 (2006年5月), .
5. **中村 教泰, 庄野 正行 :** 蛍光顕微鏡および遮蔽部材および試料観察システム, 特願2006-143441 (2006年5月), .
6. **中村 教泰 :** 新規なナノシリカ粒子の製造方法と用途, 特願2006-160107 (2006年6月), .
7. **庄野 正行, 中村 教泰 :** 蛍光顕微鏡, 特願PCT/JP2007/060466 (2007年5月), 特開WO2007/136075 (2007年11月), 特許第PC07010号 (2012年4月).
8. **中村 教泰 :** 新規なナノシリカ粒子の製造方法と用途, 特願PCT/JP2007/61587 (2007年6月), 特許第5311340号.
9. **中村 教泰 :** 新規なナノシリカ粒子の製造方法と用途, 特願PCT/JP2007/61587 (2007年6月), 特許第8,455,255号.
10. **近藤 茂忠 :** p53の発現促進方法およびそれに用いるp53発現促進剤, 特願2009-531301 (2008年9月), 特開WO2009031671 (2009年3月), 特許第WO2009031671号 (2013年5月).
11. **近藤 茂忠 :** p53の発現促進方法およびそれに用いるp53発現促進剤, 特願2009-531301 (2008年9月), 特開WO2009031671 (2009年3月), 特許第WO2009031671号 (2013年5月).
12. **近藤 茂忠 :** p53の発現促進方法およびそれに用いるp53発現促進剤, 特願2009-531301 (2008年9月), 特開WO2009031671 (2009年3月), 特許第WO2009031671号 (2013年5月).
13. **近藤 茂忠 :** p53の発現促進方法およびそれに用いるp53発現促進剤, 特願2009-531301 (2008年9月), 特開WO2009031671 (2009年3月), 特許第WO2009031671号 (2013年5月).
14. **近藤 茂忠 :** p53の発現促進方法およびそれに用いるp53発現促進剤, 特願2009-531301 (2008年9月), 特開WO2009031671 (2009年3月), 特許第WO2009031671号 (2013年5月).
15. **近藤 茂忠 :** p53の発現促進方法およびそれに用いるp53発現促進剤, 特願2009-531301 (2008年9月), 特開WO2009031671 (2009年3月), 特許第WO2009031671号 (2013年5月).
16. **林 幸壱朗 :** 金属酸化物ナノ粒子構造体の製造方法, 特願2010-187967 (2010年8月), .
17. **玉置 俊晃, 池田 康将, 土屋 浩一郎 :** マクロファージの浸潤抑制によるインスリン抵抗性改善剤, (2011年), 特許第2011-174001号 (2011年).
18. **林 幸壱朗 :** 金属酸化物ナノ粒子構造体及びその製造方法, 特願PCT/JP/2011/64173 (2011年6月), .
19. **林 幸壱朗 :** シラン化合物及びポルフィリンを含む複合体, 特願2012-054845 (2011年11月), .
20. **林 幸壱朗 :** ポルフィリン含有複合体, 特願2012-054845 (2012年3月), .